#### 05;09

## Волноводно-щелевой 60 GHz фазовращатель на основе (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub> сегнетоэлектрической пленки

# © А. Козырев, М. Гайдуков, А. Гагарин, А. Тумаркин, С. Разумов

С.-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ)

E-mail: mcl@eltech.ru

### В окончательной редакции 12 ноября 2001 г.

Представлены конструкция и СВЧ-характеристики сегнетоэлектрического фазовращателя на основе волноводно-щелевой линии, работающего в миллиметровом диапазоне длин волн ( $f \sim 60 \text{ GHz}$ ). Параметр качества фазовращателя 32 deg/dB. Фазовращатель обеспечивает непрерывное изменение фазы до 255 deg. Сегнетоэлектрические пленки показали значения диэлектрических потерь tan  $\delta = 0.04$  и управляемость  $K \approx 1.7$ , что является перспективным для их использования в данном диапазоне частот.

Исследования, проведенные ранее, продемонстрировали перспективность использования тонких сегнетоэлектрических пленок для перестраиваемых СВЧ-устройств и возможность успешной реализации на их основе фазовращателей СВЧ-диапазона до 30 GHz включительно [1,2]. Настоящая работа посвящена созданию фазовращателя на основе щелевой линии передачи с сегнетоэлектрической пленкой, работающего на частоте 60 GHz, который может быть использован в качестве прототипа элемента фазированной антенной решетки для автомобильных радиолокационных систем безопасности [3].

Конструкция фазовращателя на основе волноводно-щелевой линии показана на рис. 1. Сегнетоэлектрический элемент, представляющий собой отрезок щелевой линии на поверхности подложки из поликора  $(Al_2O_3)$  с пленкой  $Ba_xSr_{1-x}TiO_3$  (BSTO) и медной металлизацией, устанавливался вдоль волновода в плоскости *E*-поля. Изменение фазового набега СВЧ-сигнала достигалось за счет изменения диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрической пленки в зазоре щелевой линии

51



Рис. 1. Конструкция фазовращателя: *1* — сегнетоэлектрический элемент, *2* — сегнетоэлектрическая пленка, *3* — подложка (поликор), *4* — рабочий участок, *5* — пленка меди, *6* — пластина слюды с металлизацией, *7* — пластина слюды без металлизации, *8* — элементы волновода.

(длина рабочего участка 4 mm, ширина зазора ~ 6  $\mu$ m) под действием напряжения управления ( $U_b$ ). Подача напряжения и конструктивное крепление сегнетоэлектрического элемента осуществлялись за счет изолирующих пластин слюды (толщина ~ 20  $\mu$ m) с медной металлизацией. Согласование волновых сопротивлений щелевой линии и

волновода достигалось с помощью трансформаторов, топология которых рассчитывалась по соотношениям, приведенным в [4].

Используемые в работе пленки были получены на технологической установке Leybold Z-400 ионно-плазменным ВЧ магнетронным "on-axis" распылением керамической мишени состава  $Ba_x Sr_{1-x}TiO_3$  диаметром 76 mm. Осаждение пленок на подложки поликора размером  $15 \times 15$  mm и толщиной  $125 \,\mu$ m проводилось в атмосфере чистого кислорода при давлении ~ 10 Pa и температуре 905°C. Толщина получаемых пленок составляла ~  $(0.5 \div 1) \,\mu$ m. После осаждения пленки структура охлаждалась в чистом кислороде со скоростью  $2 \div 3^{\circ}$ C/min [5]. Затем на поверхность BSTO пленки методом термического испарения наносилась пленка меди толщиной ~  $1 \,\mu$ m. Топология CBЧ-схемы фазовращателя формировалась жидкостной литографией. В качестве основы для создания сегнетоэлектрических элементов фазовращателя использовались BSTO пленки состава x = 0.4 (пленка № 1) и x = 0.3 (пленка № 2). Диэлектрическая проницаемость пленок составляла  $\varepsilon(U_b = 0) = 320$  для образцов № 1 и 2 соответственно.

На рис. 2 представлены экспериментальные и расчетные зависимости фазового набега от приложенного напряжения управления. Расчет фазового сдвига проводился на основе теории многослойных волноводнощелевых структур [6]. В экспериментах образец 1 показал вносимые СВЧ-потери  $S_{21} \sim -15 \, \text{dB}$  вблизи  $f \sim 60 \, \text{GHz}$ . Потери уменьшались до  $-8 \, \text{dB}$  при приложении к рабочему элементу постоянного напряжения управления до 300 V. Непрерывное изменение фазы СВЧсигнала при этом составило  $\Delta \varphi = 394 \, \text{deg}$ . Образец № 2 показал затухание СВЧ-сигнала  $S_{21} \sim -8 \, \text{dB}$  с уменьшением до  $-6 \, \text{dB}$  при 300 V и  $\Delta \varphi = 255 \, \text{deg}$ . Согласующие элементы не были оптимизированы, что привело к  $S_{11} = -4 \, \text{dB}$ . Основным параметром, характеризующим фазовращатель, является его параметр качества  $F[\text{deg/dB}] = \Delta \varphi/S_{21}$ , который для образца 1 соответствует  $F \sim 26 \, \text{deg/dB}$  и для образца 2 —  $F = 32 \, \text{deg/dB}$  (F рассчитан по наибольшему значению  $S_{21}$ ).

Механизмами СВЧ-потерь, определяющими значение  $S_{21}$  для волноводно-щелевой линии, являются потери в сегнетоэлектрической пленке (tan  $\delta$ ) и потери в металлических электродах. Для определения декремента затухания, обусловленного потерями в металле ( $\alpha_m$ ), проводились измерения добротности волноводно-щелевых резонаторов на поликоровых подложках без пленки сегнетоэлектрика. На рис. 3 приведены полученные зависимости потерь в металле от ширины щели для частот 30



Рис. 2. Экспериментальные и расчетные характеристики фазовращателя: *I* — расчет (образец № 1), *2* — расчет (образец № 2), *3* — эксперимент (образец № 1), *4* — эксперимент (образец № 2).

и 60 GHz. Изменение волнового сопротивления линии передачи при увеличении эффективной диэлектрической проницаемости подложки ( $\varepsilon_{eff}$ ) за счет сегнетоэлектрической пленки приводит к росту потерь в металле пропорционально ~  $\varepsilon_{eff}$  [4] по отношению к данным, приведенным на рис. 2. Расчет  $\varepsilon_{eff}$  с учетом сегнетоэлектрической пленки показывает, что металлические потери для щелевой линии с шириной зазора 6  $\mu$ m могут быть оценены как  $\alpha_m \sim 0.5$  dB/mm. На основании измерения вносимого затухания сегнетоэлектрической линии и оценок потерь в металле можно определить потери в сегнетоэлектрической пленке ( $\alpha_d$ ). Для линий на основе пленок № 1 и 2 значения  $\alpha_d$  составляли



Рис. 3. Декремент затухания, определяющийся СВЧ-потерями в металлической пленке щелевой линии.

 $\alpha_{d1} \approx 3.5 \, \text{dB/mm}$  и  $\alpha_{d2} \approx 1 \, \text{dB/mm}$ . Таким образом, для данного диапазона частот (~ 60 GHz) выявляется преобладание диэлектрических потерь над потерями в металле и соответственно устанавливается ведущая роль качества сегнетоэлектрической пленки. Именно снижение роли металлических потерь на этих частотах позволяет уменьшить зазор линии до ~ 6  $\mu$ m, что обеспечивает возможность снижения управляющих напряжений.

Анализ  $\alpha_d$  позволяет оценить тангенс потерь пленок № 1 и 2 как tan  $\delta_1 \approx 0.12$  и tan  $\delta_2 \approx 0.04$ . Пленки продемонстрировали управляемость  $K_1 = \varepsilon(0V)/\varepsilon(300 V) \approx 2$  и  $K_2 \approx 1.7$ . Параметр качества сегнетоэлектрических пленок, определяющий пригодность их использования на CBЧ, описывается соотношением  $p = (K - 1)^2/K$  tan  $\delta_0$  tan  $\delta_U$  [7], где tan  $\delta_0$  и tan  $\delta_U$  — потери в сегнетоэлектрической пленке без приложенного напряжения управления и при  $U_b \neq 0$ . Для пленки № 2  $p \approx 250$ ,

что позволяет создание управляющих устройств миллиметрового диапазона с очень высокими параметрами. В частности, при оптимизации согласующих элементов фазовращателя его параметр качества может достигнуть F = 40 deg/dB.

### Список литературы

- [1] Козырев А., Иванов А., Солдатенков О. и др. // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. В. 20. С. 78–83.
- [2] Carlson C.M., Rivkin T.V., Parilla P.A. et al. // Applied Physics Letters. 2000.
  V. 76. N 14. P. 1920–1922.
- [3] Qian Y., Itoh T. // IEEE Transactions on MTT. 1998. V. 46. N 11. P. 1891–1900.
- [4] *Gupta K.C., Ramesh Garg, Inder Bahl* et al. Microstrip Lines and Slotlines, Second Edition. Artech House, 1996.
- [5] Rasumov S., Tumarkin A., Buslov O., Gaidukov M., Gagarin A., Ivanov A., Kozyrev A. Electrical properties of magnetron sputtered thin BaSrTiO<sub>3</sub> films depending on deposition conditions. Integrated ferroelectrics, 2001 (in press).
- [6] Мироненко И.Г., Иванов А.А. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. В. 13. С. 16-21.
- [7] Вендик О.Г., Мироненко И.Г., Тер-Мартиросян Л.Т. // Изв. АН СССР. 1987. Т. 51. В. 10.